

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319 del 14 dicembre 2018)

Alla pagina 129, al sotto punto 3B001. f., l'allineamento dei punti 3 e 4 è rettificato come segue:

anziché: «3. apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio "laser"; e
- b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione del punto FWHM (larghezza a mezza altezza) inferiore a 65 nm e valore di posizionamento dell'immagine inferiore a 17 nm (media + 3 sigma); o
 2. non utilizzato;
 3. errore di sovrapposizione del secondo strato inferiore a 23 nm (media + 3 sigma) sulla maschera;
 4. apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. fascio elettronico focalizzato deflesso; e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione minima del fascio uguale o inferiore a 15 nm; o
 2. errore di sovrapposizione inferiore a 27 nm (media + 3 sigma);»

leggasi: «3. apparecchiature appositamente progettate per la produzione di maschere aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. un fascio elettronico focalizzato deflesso, un fascio ionico o un fascio "laser"; e
- b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione del punto FWHM (larghezza a mezza altezza) inferiore a 65 nm e valore di posizionamento dell'immagine inferiore a 17 nm (media + 3 sigma); o
 2. non utilizzato;
 3. errore di sovrapposizione del secondo strato inferiore a 23 nm (media + 3 sigma) sulla maschera;
4. apparecchiature progettate per il trattamento di dispositivi con metodi di scrittura diretta, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. fascio elettronico focalizzato deflesso; e
 - b. aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. dimensione minima del fascio uguale o inferiore a 15 nm; o
 2. errore di sovrapposizione inferiore a 27 nm (media + 3 sigma);»
